

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>  
H01L 21/268

(11) 공개번호 특1997-0052182  
(43) 공개일자 1997년07월29일

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| (21) 출원번호 | 특1995-0067231                             |
| (22) 출원일자 | 1995년12월29일                               |
| (71) 출원인  | 엘지반도체 주식회사      문정환                       |
| (72) 발명자  | 충청북도 청주시 흥덕구 향정동 1번지 (우 : 360-480)<br>김창현 |
| (74) 대리인  | 경상북도 구미시 임수동 171번지<br>심창섭, 김용인            |

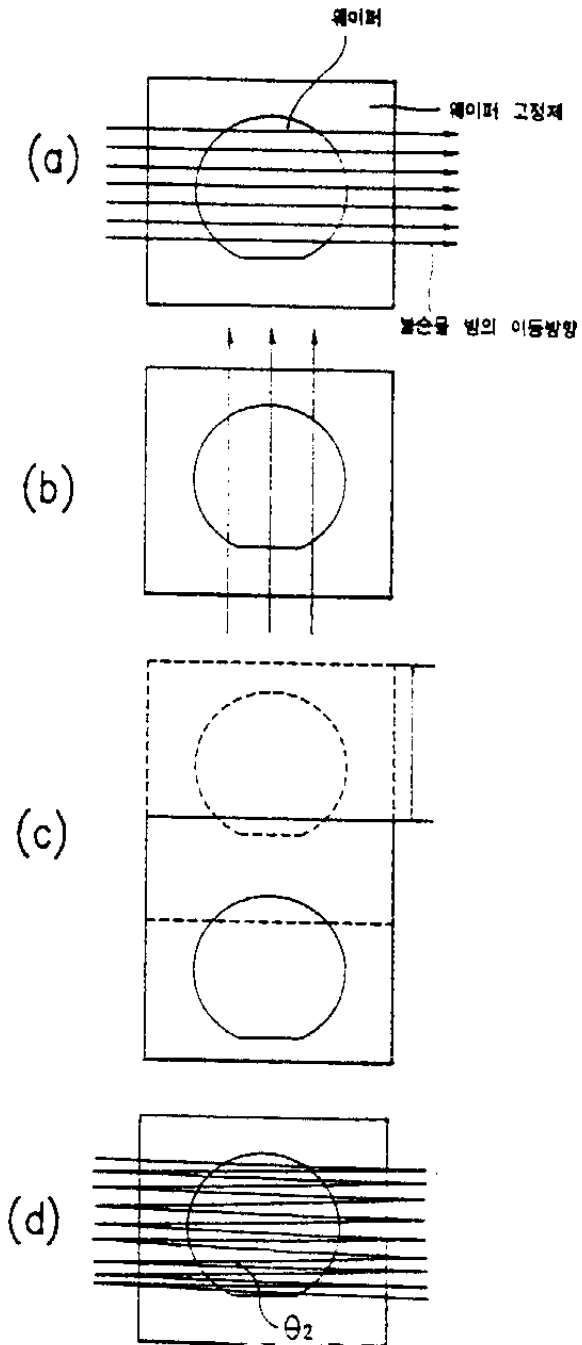
**심사청구 : 있음**

**(54) 불순물 주입방법**

**요약**

본 발명은 불순물 주입방법에 관한 것으로, 웨이퍼에 불순물 주입에 따른 불순물 분포의 균일성을 향상시키는데 적당한 불순물 주입방법을 제공하기 위한 것이다. 이를 위한 본 발명의 불순물 주입방법은 반도체 소자 제조공정의 불순물 주입에 있어서, 이온화된 불순물 빔의 X축 이동방향과 Y축 이동방향, 그리고 웨이퍼 고정체의 Y축 이동방향의 복합적인 이동방향으로 이온화된 불순물 빔을 이동시켜 웨이퍼에 조사(照射)함을 특징으로 한다.

## 대표도



## 명세서

[발명의 명칭]

불순물 주입 방법

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명의 불순물 주입방법을 나타낸 도면.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

## (57) 청구의 범위

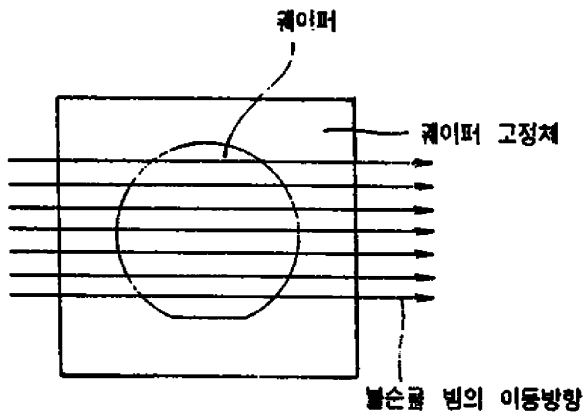
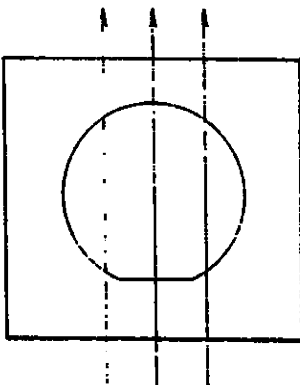
**청구항 1**

반도체 소자 제조공정의 불순물 주입에 있어서, 이온화된 불순물 빔의 X축 이동방향과 Y축 이동방향, 그리고 웨이퍼 고정체의 Y축 이동방향의 복합적인 이동방향으로 이온화된 불순물 빔을 이동시켜 웨이퍼에 조사(照射)함을 특징으로 하는 불순물 주입 방법 .

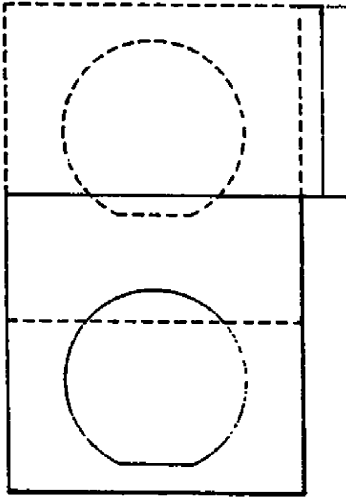
**청구항 2**

제1항에 있어서, 상기 이온화된 불순물 빔의 X축 이동방향, Y축 이동방향, 웨이퍼 고정체의 Y축 이동방향에 따른 각각의 이동 속도비는 100 : 10: 1로 함을 특징으로 하는 불순물 주입 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면****도면3a****도면3b**

도면3c



도면3d

